

SP-15000D



## ・特徴

実験用の小型装置ですが、大型ターゲットとクライオポンプによるドライ系排気が特徴です。Al や Al-Si 膜のように、残留ガス(酸素、水分等)の存在が問題になるようなスパッタリング実験に適しています。設置床面積も小さく、使い易い装置です。

## ・仕様

到達圧力	×10 <sup>-5</sup> Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	×10 <sup>-4</sup> Pa 台迄 15 分以内※常温・無負荷・脱ガス時
成膜室径	φ450mm×250mmH SUS304 電解研磨
スパッタ用電源	DC 電源 700V 5KW 1 台
基板形状	4 インチ 1 枚
膜厚分布	±15%以内
ターゲット寸法	6 インチ(金属膜)
ターゲット個数	1
基板回転	無し
基板加熱	常温~300℃迄昇温可能
真空排気系	油回転ポンプ : 253L/min クライオポンプ : 680L/sec
操作方法	手動
ガス系統	マスフローコントローラ 1 系統
ユーティリティ	電気 : AC200V 三相 16KVA 冷却水 : 15L/min 以上 0. 1MPa 以上 0. 15MPa 以下 25℃以下循環 計装エア : 0. 5MPa 以上 設置寸法 : 1200mmW×1000mmD×1500mmH